



PCT

特許協力条約に基づいて公開された国際出願

<p>(51) 国際特許分類6 H01L 21/027</p>	<p>A1</p>	<p>(11) 国際公開番号 WO00/17916</p> <p>(43) 国際公開日 2000年3月30日(30.03.00)</p>
<p>(21) 国際出願番号 PCT/JP99/04989</p> <p>(22) 国際出願日 1999年9月13日(13.09.99)</p> <p>(30) 優先権データ 特願平10/262802 1998年9月17日(17.09.98) JP</p> <p>(71) 出願人 (米国を除くすべての指定国について) 株式会社 ニコン(NIKON CORPORATION)[JP/JP] 〒100-8331 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル Tokyo, (JP)</p> <p>(72) 発明者 ; および (75) 発明者 / 出願人 (米国についてのみ) 鈴木広介(SUZUKI, Kousuke)[JP/JP] 〒100-8331 東京都千代田区丸の内三丁目2番3号 富士ビル 株式会社 ニコン 知的財産部内 Tokyo, (JP)</p> <p>(74) 代理人 大森 聡(OMORI, Satoshi) 〒214-0014 神奈川県川崎市多摩区登戸2075番2-501 大森特許事務所 Kanagawa, (JP)</p>		<p>(81) 指定国 AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM)</p> <p>添付公開書類 国際調査報告書</p>
<p>(54)Title: <u>METHOD OF ADJUSTING OPTICAL PROJECTION SYSTEM</u></p> <p>(54)発明の名称 投影光学系の調整方法</p> <p>(57) Abstract A method of adjusting an optical projection system is provided, in which the relation (dependence) between the amount of change in imaging characteristics of the optical projection system and the change in the installation environment can be measured in a short time without changing the installation environment (e.g., atmospheric pressure) of the optical projection system. Light (IL) from a light source (1) illuminates a reticle (9) through fly-eye lenses (2,4) and a condenser lens (8), and the pattern image of the reticle (9) is projected to a wafer (12) through an optical projection system (11). Since the change in wavelength of the light (IL) and the change in ambient pressure (substantially equal to atmospheric pressure) are substantially equivalent as viewed from the optical projection system (11), the atmospheric dependence of the imaging characteristic is measured by measuring the amount of change in the imaging characteristic while varying the wavelength of the light (IL).</p>		